

戸田昭彦\*

# 高分子の結晶化

## 1. はじめに

結晶性高分子は通常の条件下では高々数十 nm 程度の非 常に薄いラメラ晶として結晶化する. すなわち, 高分子結 晶化の最も大きな特徴は, 分子鎖が厚さ方向に折り畳まれ て結晶化する様式である。分子鎖の折り畳み方はタンパク 質の場合とは異なり、一意的に決まっているわけではない. すなわち, 高分子鎖の折り畳み鎖結晶化は, 結晶化のキネ ティクスにより決められていると考えられている. そこで、 折り畳み鎖結晶化キネティクスを理解することが、結晶性 高分子材料の構造制御には不可欠となる. 一方, ポリエチ レン、PET やポリプロピレンなど、多くの結晶性高分子 材料では、結晶・非晶の積層構造が織りなす多彩な高次構 造が発現する (図1). これらの構造を理解することも、 結晶性高分子材料の構造・物性制御には重要である. 高分 子の折りたたみ鎖単結晶は 1957 年に発見され<sup>1)~3)</sup>, 50 年 を経た今では膨大な研究の歴史がある1/~10).しかし一方で は、未だ、その本質的な部分について新たな提案もなされ ており、依然として数多くの明らかにされるべき点を抱え ている分野でもある. そこで本稿では, 高分子結晶に関す るこれまでの理解のされ方について、その問題点も含めて 解説していく.

#### 2. 結晶化の律速過程

結晶性高分子の最も安定な状態は、伸びきった高分子鎖 が束ねられて結晶化している状態である.しかし、溶融状 態あるいは溶液への溶解状態では、高分子鎖はランダムな 糸まり状の構造を取っている.これらの状態間の差異はあ まりにも大きく、過冷却状態に置かれた高分子鎖は、最安 定状態に向かう途中の準安定状態である折りたたみ鎖結晶 として、まず結晶化する.ポリエチレンの高圧相のように、 結晶内部での分子鎖の運動性が十分に高い場合には、結晶 内部での分子鎖の滑り拡散によって、より安定な厚い結晶 へと変化していき、最終的に伸びきり鎖で構成される最安 定な構造をとるものと考えられている<sup>110.129</sup>.伸びきり鎖に まで転化できなくても、融点近傍の高温で結晶内部の分子 運動が活発な状態では、結晶厚化などの再組織化や、一旦融

\* Toda, Akihiko 広島大学 大学院総合科学研究科 東広島市鏡山 1-7-1 (〒739-8521) 2007.1.7 受理



(e)

図1 結晶性高分子の多彩な高次構造

解した後の再結晶化など、準安定な結晶ならではの多彩な 変化が現れる<sup>51</sup>.これらの変化は図2のような各状態間の ギブスの自由エネルギー変化を考慮することで理解される

#### 成形加工 第 20 巻 第 2 号 2008



図2 高分子結晶─溶融体のギブズ自由エネルギーの 温度依存性

折り畳み鎖結晶化に関して実験的に測定される量は,折 り畳み周期で決められるラメラ結晶の厚さと,折り畳み速 度で決められる結晶成長速度である.これらの量がどのよ うに実験的に整理されるのかを,まず解説する.結晶厚さ  $\ell$ は,結晶化の駆動力である過冷却度 $\Delta T = T_m - T_c$ ,すな わち伸びきり鎖結晶の平衡融点 $T_m$ あるいは平衡溶解温度  $T_a$ と実際の結晶化温度 $T_c$ との差を用いることにより,次 式で表される<sup>3</sup>.

$$\ell = \delta \ell + \frac{A}{\Delta T} \tag{1}$$

ここで、 $\delta \ell$ とはA、定数である.このように、結晶の厚 さ(折り畳み周期)が結晶化の駆動力である過冷却度 $\Delta T$ で決められていることは、結晶化のキネティクスが厚さの 決定要因であることを意味している.一方、溶融体からの 結晶成長速度Vは、結晶の平衡融点 $T_m$ とガラス転移点 $T_g$ で挟まれた釣り鐘形の温度依存性を示す(図3a).その要 因は、高温側では駆動力 $\Delta T$ の低下、低温側ではガラス 転移点に近づくことによる分子運動性の低下である.これ らの要因の結晶成長速度に与える影響は分離して考えるこ とができる.すなわち、ガラス転移が関与する分子の運動 性は、各過程の頻度因子の変化として、次式のように Vogel-Flucher型(WLF型)として表される.

$$\beta \propto \exp\left[-\frac{U^*}{R\left(T-T_{\infty}\right)}\right]$$
(2)

ただし、 $U^*$ と $T_{\infty}$ は、ガラス転移に関係する定数である. 一方、運動性の変化を除いた部分は、結晶化キネティクス の駆動力  $\Delta T$ に対する依存性で決まり、実験的に得られ る結晶成長速度 V は次式のように整理される(図 3 b).

$$\frac{V}{\beta} \propto \exp\left[-\frac{K}{T\Delta T}\right]$$
(3)

ここで, K は定数である.

これらの結晶厚や結晶成長速度を説明する標準的なモデ ルとされる考え方が、Lauritzen と Hoffman による表面核 形成律速に基づくモデル(L-H モデル)である<sup>®</sup>. この標



図3 溶融体からのポリエチレンテレフタレート球晶の成 長速度.(a)結晶化温度依存性,(b)式(3)による フィッティング

準モデルでは,結晶化した体積に比例するバルクの自由エ ネルギー低下分に加えて,折りたたみ鎖がつくる端面(フォ ルド面)と側面の表面自由エネルギー不利を考慮する.

端面の表面自由エネルギー  $\sigma_{e}$ の主要部は,分子鎖の折 り畳みに伴うエネルギー不利であり,少なくともこの不利 分を補償できるだけバルクの自由エネルギーは低下してい なければならない.すなわち,結晶化が継続できる結晶厚 には下限がある.結晶化に伴う単位体積当たりの自由エネ ルギー減少分を  $\Delta g$ ,融解熱を  $\Delta h_{f}$ とすると,この下限厚 さは次式のように表される.

$$\ell_{\min} = \frac{2 \sigma_{e}}{\Delta g} = \frac{2 \sigma_{e} T_{m}}{\Delta h_{f}} \frac{1}{\Delta T}$$
(4)

そこで、式(4)の ΔT 依存性が、式(1)の結晶厚さの温度 依存性を表し、係数が上式のように与えられると考えられ ている.結晶化が継続するとき、全自由エネルギーは低下 しているはずなので、実際の結晶厚は、この下限厚よりも 厚いはずである.式(1)の定数因子 δℓ がこの自由エネル ギー利得分を表していると考える.

一方,結晶化キネティクスに関しては,図4のように, 平らな成長面上での新たな結晶層の形成過程が結晶化の律 速段階であると考える.表面核形成には,端面での表面自 由エネルギー不利に加えて,側面の不利が付随する.そこ で,小さなサイズの新たな結晶層には自由エネルギー障壁 が生じ,この障壁を乗り越える過程が表面核形成過程とな る.表面核の成長過程は,表面核に含まれる結晶ステムの 長さℓと本数 n で張られる自由エネルギー曲面上の反応 経路として表される.この曲面は鞍形となり,核形成の頻 度*i* は鞍部点の高さで決まり,一般には次式のように表さ れる.

$$i \propto \exp\left[-\frac{4 b \sigma \sigma_e T_m}{k_B \Delta h_f} \frac{1}{T \Delta T}\right]$$
(5)

Seikei-Kakou Vol. 20 No. 2 2008



図5 (a) 高分子結晶成長先端のピニング領域と(b) 低 分子結晶成長面上の1次元ステップ

ここで、 $k_B$ はボルツマン定数、 $\sigma$ は表面核側面の表面自 由エネルギー、bは単位結晶層の成長方向の厚さである (図 4). 核形成頻度 i は成長速度 V の決定要因であり、式 (5)によって式(3)の依存性が説明される.

元々の L-H モデル<sup>®</sup>では最初のステムの形成過程を律速 段階と捉えている.フォルドに伴う反応経路の分岐過程に 基づく詳細なモデルが Point により提案されている<sup>13</sup>.ま た,結晶内での分子鎖の滑り拡散が容易な場合には,表面 核の厚さ方向への成長(厚化成長)も取り込む一般化が, 彦坂により提案されている<sup>12</sup>.

表面核形成だけでなく,溶融体から新たな結晶が析出し 始める場合にも核形成(1次核形成)が重要であることは, 核剤の選択が成形加工において重要であることからも明ら かであろう.1次核形成には,結晶化前の溶融状態での熱 処理が大きく影響することが知られている(メルトメモ リー効果<sup>14)</sup>).溶融体内部での絡み合い密度の変化や核剤 表面の活性の変化がその原因として想定される.

核形成に基づく標準モデルと全く異なる立場からの結晶 化モデルとして、エントロピー障壁に基づくモデルが Sadler と Gilmer により提案されている<sup>15)</sup>.結晶の成長先 端は低分子における1次元ステップに相当し、エントロ ピーの効果により有限の温度では必ず荒れた形状になる (図 5).すなわち、高分子結晶の成長先端では、短い周期 で折り畳まれたステムが付着した構造(ピニング領域)が エントロピー効果によって安定に存在する<sup>16</sup>.低分子の1 次元ステップは成長単位の出入りにより自由に前後に移動 できる.高分子結晶のピニング領域は結晶内部での分子鎖 の易動度が大きくない限り,自由に移動することができな い.このピニング領域をもつ成長先端の移動がエントロ ピー障壁をもつモデルとして提案されている.エントロ ピー障壁は結晶厚さに比例し,表面核形成律速の場合の 式(5)と同様な成長速度の過冷却度依存性が,このモデル で説明される.

#### 3. 結晶成長様式

図2に示されるように、元来折りたたみ鎖結晶は準安定 状態にある.最安定な相(この場合は伸びきり鎖結晶)に なる前に、準安定な相(折りたたみ鎖結晶)が現れる現象 は、「Ostwald の段階則」として、古くから高分子以外の 多くの系でも知られている。高圧下のポリエチレンでも伸 びきり鎖として成長する六方晶が準安定な温度・圧力域で 得られる.相の現れる順番は相転移キネティクスの速さで 決められる. すなわち、より速く転移できる相が優先的に 現れる、このような例と同様な類推で、折りたたみ鎖結晶 が現れる前に、準安定な中間相が一旦成長する可能性が指 摘されている<sup>17)~20)</sup>. 中間相への転移では, バルクの自由エ ネルギー減少分は相対的に小さくても、中間相の構造が液 相に近いために液相との界面自由エネルギー不利が小さく, 中間相への転移キネティクスの方が結晶相への転移よりも 速くなりうるからである.また、液晶的な配向秩序化が1 次核形成の予備段階として生じている可能性が梶ら18%によ り提案されている。モノトロピックな液晶性高分子では、 等方性液体から結晶化した場合と、液晶から結晶化した場 合の両方を実現することができ,液晶から結晶化した場合 に結晶化速度が数倍上昇することが報告されている<sup>19</sup>.他 方では,結晶の成長先端が,進安定な中間相で構成されて いる可能性も指摘されている17,200.これは、中間相の折り たたみ鎖端面の表面自由エネルギー不利 σ。が結晶相の不 利よりも小さいときに起こりうる現象で、例えば、各相間 の転移における比  $\sigma_{e}/\Delta h_{f}$ が以下の関係にあるとき,図 6 a のような結晶厚さに対する安定相の図が描ける".

$$\left(\frac{\sigma_{\rm e}}{\Delta h_f}\right)_{\rm M-C} > \left(\frac{\sigma_{\rm e}}{\Delta h_f}\right)_{\rm L-C} > \left(\frac{\sigma_{\rm e}}{\Delta h_f}\right)_{\rm L-M} \tag{6}$$

ただし、添字 L-C は等方性液体-結晶、L-M は等方性液 体-中間相、M-C は中間相-結晶間を表す、図 6 のように、 厚さの薄いラメラ晶では、相の安定性の逆転が起こり、中 間相が最安定となる、中間相内では分子鎖の運動性が高い と考えられるので、結晶の厚化が起こる、図 6 a の矢印の ように厚化が進めば、ある臨界厚さ以上では結晶相が安定 相となる、実験的な検証は非常に困難ではあるが、このよ うな中間相→結晶相の変化がくさび状の結晶の成長先端で 起こる状況が想定されている<sup>(7).20)</sup></sup>(図 6 b).</sup>

成長表面上での表面核形成頻度が与えられたとき,実際の成長面の成長速度は、この表面核形成頻度 *i* と核形成によって新たに形成された層の結晶化による伝搬速度 *g* の 2 つの速度因子で決められ、3 つの成長様式があるとされて

成形加工 第 20 巻 第 2 号 2008







図 6 (a) ラメラ晶の融点 T<sub>L-0</sub>, 転移点 T<sub>M-C</sub> の厚さ 依存性と(b) 結晶成長先端に想定される中間相

いる<sup>21)</sup>.1つは伝搬速度が非常に遅いときに,一つの核形 成で1層が完成される様式で,単一核形成様式(レジー ム1)と呼ばれる.2つ目は多数の核による成長層の生成・ 合体により1層が完成される様式で,多核形成様式(レジー ム2)と呼ばれる.最後に,より核形成頻度が増した様式 がレジーム3と呼ばれる.それぞれの場合に結晶成長速度 Vが以下のようにiとgによって表される.

$$V = biL \quad \forall \vec{\mathcal{Y}} - \Delta 1$$
  

$$V = b (ig)^{1/2} \quad \forall \vec{\mathcal{Y}} - \Delta 2 \qquad (7)$$
  

$$V \propto bi$$

ここで、bは層の高さ、Lは基盤の幅である(図4). 伝搬 速度gの過冷却度依存性は小さいと考えられるので,成 長速度の過冷却度依存性は表面核形成頻度iで決められる  $(G \propto i(\nu \neg - \Delta 1), i^{1/2}(2), i(3))$ . そこで、これらの様 式間の変化は過冷却度依存性の変化として見えてくる.実 際に成長様式の変化はポリエチレン<sup>22)</sup>やポリプロピレン<sup>23)</sup> など多くの高分子で確認されている. レジーム1の場合, 成長速度は基盤幅Lに比例する. そこで、Lが結晶の幅 に相当する場合には成長が指数関数的になることが予想さ れるが、実際には成長速度は一定である.通常の成長では、 基盤幅は成長面の欠陥間の幅で決まっていると考えられて いる.ポリエチレンの場合には成長様式の変化と結晶成長 形の変化が図7のように同時に起こり、高温のレジーム1 成長では成長面幅が一定に保たれる機構が成長形の制約に よって実現されている<sup>24)</sup>.また,図7のポリエチレン結晶 は {100} 成長面が丸みを帯びた外形になっている. 層ご とに完成していく表面核形成律速を前提とした場合、丸い



図7 (a)溶融体からのポリエチレン球晶の成長速度と(b) 式(3)によるプロット.(c)高温側(レジーム1)と(d) 低温側(レジーム2)での単結晶の形態(電子顕微 鏡像 Bar=1 μm)と(e)高温側結晶先端の概略図

成長面が現れるためには特別な機構が必要とされる.ポリ エチレンの場合には、同族体のアルカンの伸びきり鎖成長 でも観察されているような<sup>25)</sup>、上述のピニング効果による 成長層伝搬の停滞・蓄積がその原因と考えられている.

#### 4. 高次構造

結晶性高分子は図1のような多彩な高次構造を形成する. すなわち,(1)もとになる結晶構造は分子鎖のパッキング で決められる.(2)高分子単結晶では分子鎖は上下の面で 折り畳まれて結晶化している.(3)フォルド面は必然的に

Seikei-Kakou Vol. 20 No. 2 2008



図 8 溶融体から結晶化したポリエチレンバンド球晶の偏 光顕微鏡像 (Bar=20 μm)

非晶部であり,結晶化しなかったシリア,結晶間のタイ分 子等も含めて,高分子結晶の構造は基本的に結晶・非晶の 積層構造となる.この積層構造の周期に関しては溶融状態 での分子鎖の拡がりとの相関が指摘されている.(4)板状 の結晶が非結晶学的な方向への枝分かれを繰り返すことに より,3次元空間を密に充填してつくった微結晶の球対称 な集合体構造が球晶である.多くの高分子球晶では,図8 のような同心円状の美しいパターンが現れる(バンド球晶 ないしはリング球晶とよばれる).(5)多数の1次核から 成長し始めた球晶で埋まった構造が最終的に得られる高次 構造である.核形成-成長過程によって球晶で埋まった部 分(結晶化度)の時間発展は,いわゆるアブラミプロット により解析することができ,熱測定や散乱・回折法によっ て得られる結晶化度の時間発展の解析に用いられている.

高分子単結晶の立体構造は、折り畳み面を持つため非常 に複雑なものとなる。折り畳み部は非晶であるため、結晶 内部での一本の分子鎖の断面積よりも広い面積が必要とさ れる.このような上下の面の立体障害のため、高分子結晶 は必然的に歪みを持った構造を取る. 歪みが上下で非対称 な場合や、分子鎖の折り畳み向きに関して異方的である場 合には、板状晶がスクロールした形や捻れた形を取る<sup>9</sup>. 一方、分子鎖がフォルド面に対して傾斜すれば、フォルド 面での折り畳み鎖一本当たりの断面積は広くなるので、立 体障害を解消することができる. 傾斜の向きが成長面(折 り畳みの向き)に垂直であれば(図9a),各成長面ごとに 傾斜方向が異なるテント状の立体形が作られる(図9c). 傾斜が成長面に平行な場合には、成長面ごとの傾斜の向き を整合することができず、全体としては平板状の形態を取 らざるを得なくなる.そこで,成長面に平行な多数の座屈 変形によって平板歪みの緩和がなされている(図9b)<sup>27)</sup>.

球晶形成には非結晶学的な向きへ板状晶の分岐が十分な 頻度で起こる必要がある.分岐に関しては、成長界面近傍 での不純物拡散の勾配による界面不安定性の可能性が従来 から指摘されている<sup>283</sup>.揺らぎによって平均位置から飛び 出た成長面は、より薄い不純物濃度の下で成長できるので





### 図 9 成長面に(a)垂直,(b)平行な分子鎖の傾斜と(c)垂 直な場合のテント型のポリエチレン単結晶(希薄溶 液から成長)の AFM 像(一辺=5 µm)<sup>26)</sup>

揺らぎ成長が促進されることになる.分岐の特徴的な長さ は、勾配の度合いを表す拡散長 $\delta = D/V$  (D は拡散係数) で決められる.高分子鎖の拡散は非常に遅いので、拡散長 はサブミクロンの非常に小さな長さになる.標準的なモデ ルである Mullins-Sekekar モデル<sup>29)</sup>では特徴的な長さは  $\delta^{12}$ に比例する.

界面不安定性により枝分かれした結晶がランダムに向き を変えて得られた構造が通常の球晶であると考えられる. 一方,同心円状のパターンが見られるバンド球晶では,板 状晶は一定の向きに捻れながら向きを揃えて枝分かれして いるはずである.捻れ歪みの起源としては,前述のフォル ド面での折り畳み分子鎖のつくる非対称・非等方的な応力 が想定されている.歪みが緩和される傾斜したフォルド面 をもつ場合にも,傾斜することで上下の非対称性がさらに 顕著になる機構が提案されている<sup>300</sup>.また,緩和したテン ト型の立体形ではなく,歪みを残したイス型の立体形がバ ンド球晶が生成する結晶化条件で現れることが実験的に確 認されている<sup>310</sup>.

## 4.まとめ

以上,高分子の結晶化について概観した.高分子の結晶 化は基本的には核形成-成長型の律速機構によって説明で きる現象である.球晶などの高次構造形成には結晶化が自 発的に作る濃度勾配などの場の影響を考慮する必要がある. 中間相の役割については,実験的な検証が非常に困難であ るが,これからの進展が望まれる.

#### 謝 辞

本稿で解説した研究成果の一部は,特定領域研究「非平 衡ソフトマターの物理」の支援を受けた.ここに,深く感 謝いたします.

## 参考文献

- 1) Keller, A.: Phil. Mag., 2, 1171 (1957)
- 2) Till, P. H. Jr. : J. Polym. Sci., 24, 301 (1957)
- 3) Fischer, E. W. : Z. Naturforch., 12 a, 753 (1957)
- 4) Geil, P. H.: "Polymer Single Crystals" (1963), John Wiley, New York.
- 5) Wunderlich, B.: "Macromolecular Physics" (1976), Academic Press, New York.
- 6) Hoffman, J. D., Davis, G. T. and Lauritzen, J. I. Jr.: "Treatise on Solid State Chemistry" (1976), Hannay, N. B. (Ed.), Plenum, Vol. 3, Chap. 7
- 7) Magill, J. H.: J. Mater. Sci., 36, 3143 (2001)
- 8) Bassett, D. C. : J. Macromol. Sci., B 42, 227 (2003)
- 9) Lotz, B. and Cheng, S. Z. D. : Polymer, 46, 577 (2005)
- 10) 奥居徳昌:高分子の結晶(高分子サイエンスOne Point)(1993),共立出版
- Wunderlich, B. and Arakawa, T. : J. Polym. Sci., A 2, 3697 (1964)
- 12) Hikosaka, M. : Polymer, 28, 1257 (1987)
- 13) Point, J. J. : Macromolecules, 12, 771 (1979)
- 14) Yamazaki, S., Gu, F., Watanabe, K., Okada, K., Toda, A., Hikosaka, M. : *Polymer*, **47**, 6422 (2006)
- 15) Sadler, D. M., Gilmer G. H. : Phys. Rev. Lett., 56, 2708 (1986)
- 16) Toda, A.: J. Chem. Phys., 18, 8446 (2003)
- 17) Keller, A., Hikosaka, M., Rastogi, S., Toda, A. Barham,

P. J., Goldbeck-Wood, G. : J. Mater. Sci., 29, 2579 (1994)

- 18) Imai, M., Mori, K., Mizukami, T., Kaji, K. and Kanaya, T.: *Polymer*, **33**, 4451 (1992)
- 19) Jing, A. J., Taikum, O., Li, C. Y., Harris, F. W., Cheng, S. Z. D. : *Polymer*, 43, 3431 (2002)
- 20) Strobl, G. R. : Eur. Phys. J., E 3, 165 (2000)
- 21) Hoffman, J. D., Miller, R. L. : Polymer, 38, 3151 (1997)
- 22) Armistead, J. P., Hoffman, J. D. : Macromolecules, 35, 3895 (2002).
- 23) Clark, E. J., Hoffman, J. D. : Macromolecules, 17, 878 (1984)
- 24) Toda, A.: Colloid Polym. Sci., 270, 667 (1992)
- 25) Ungar, G., Zeng, X.-B. Chem. Rev., 101, 4157 (2001)
- 26) Toda, A., Okamura, M., Hikosaka, M., Nakagawa, Y.: Polymer, 44, 6135 (2003)
- 27) Taguchi, K., Miyamoto, Y., Miyaji, H., Izumi, K.: Macromolecules, 36, 5208 (2003)
- 28) Keith, H. D., Padden Jr., F. J. : J. Appl. Phys., 34, 2409 (1963)
- 29) Mullins, W. W., Sekerka, R. F. : J. Appl. Phys., 34, 323 (1963).ibid. 35, 444 (1964)
- 30) Keith, H. D., Padden Jr., F.J. : Polymer, 25, 28 (1984)
- 31) Toda, A., Okamura, M., Hikosaka, M., Nakagawa, Y.: *Polymer*, **46**, 8708 (2005)